# Sistema de microscópios BX53M/BXFM Microscopia avançada simplificada





# Desenvolvido para aplicações industriais e de ciência dos materiais



Projetada pensando na modularidade, a série BX3M oferece versatilidade para uma ampla variedade de aplicações industriais e de ciência de materiais. Com integração otimizada com o software PRECiV™, o BX3M oferece um processo de trabalho ideal para usuários de microscopia padrão ou de formação de imagens digitais, da observação à criação de relatórios.

# Microscopia avançada simplificada

### Fáceis de usar

A operação simplificada e guiada das configurações do microscópio facilita o ajuste e a reprodução das configurações do sistema.

### **Funcionais**

Desenvolvido para microscopia industrial tradicional, o BX3M expandiu suas funcionalidades para satisfazer uma gama superior de aplicações e técnicas de inspeção.

# Óptica de precisão

Temos um longo histórico de produção de ópticas de qualidade, fornecendo imagens superiores nas oculares e no monitor.

# Completamente personalizável

O design modular proporciona a flexibilidade de criar um sistema que satisfaça suas necessidades específicas.

# Controles intuitivos de microscópio: Confortável e fácil de usar

Ao realizar tarefas de inspeção, normalmente o processo de ajuste das configurações do microscópio, aquisição de imagens e obtenção das medições necessárias a fim de satisfazer os requisitos de geração de relatórios consome bastante tempo. Talvez, você precise investir tempo e dinheiro em treinamento na área de microscopia profissional, ou precise trabalhar com conhecimento limitado sobre o potencial integral de um microscópio.

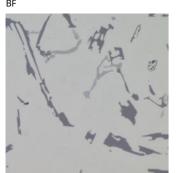
Com seus controles bem projetados e fáceis de usar, o microscópio BX3M simplifica as tarefas complexas de microscopia. Você pode aproveitar ao máximo o microscópio sem a necessidade de uma formação especializada. A operação fácil e confortável do equipamento também melhora a reprodutibilidade, minimizando os níveis de erro humano.

#### Iluminador simples: Técnicas tradicionais simplificadas

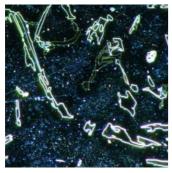
O iluminador minimiza a necessidade de ações complexas geralmente necessárias durante a operação do microscópio. O indicador na parte frontal do iluminador permite que você altere facilmente o método de observação. É possível alternar rapidamente entre os métodos de observação usados mais frequentemente na microscopia de luz refletida, como campo claro, para campo escuro ou luz polarizada, alternando rapidamente entre diferentes tipos de análise. Além disso, a observação de luz polarizada simples é ajustável ao girar o analisador.







Amostra polida de AlSi



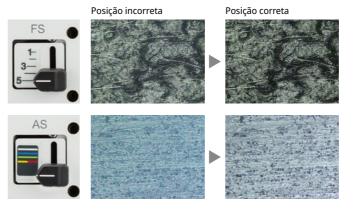




\*Requer o controle deslizante de DIC para uso

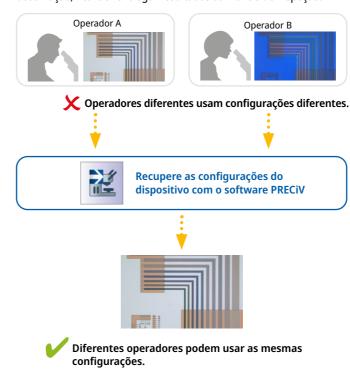
#### Controles intuitivos de microscópio

A utilização das configurações adequadas de diafragma de abertura e diafragma de campo proporciona um excelente contraste na imagem e faz o melhor uso da abertura numérica da objetiva. A legenda orienta você para a configuração correta com base no método de observação e na objetiva usados.



#### Restaure facilmente as configurações do microscópio: Hardware codificado

As funções codificadas fazem parte das configurações de hardware da série BX3M com o software de análise de imagem PRECiV<sup>™</sup>. O método de observação, a intensidade de iluminação e a ampliação são registrados automaticamente pelo software e armazenados em conjunto com as imagens associadas. Como sempre é possível realizar as inspeções usando as mesmas configurações de observação, fica fácil entregar resultados confiáveis de inspeção.



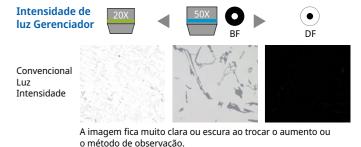
#### Índice de escala de foco: Localize o foco rapidamente

O índice da escala de foco na estrutura auxilia no acesso rápido ao ponto focal. Os operadores podem ajustar o ponto focal sem visualizar a amostra através de uma ocular, poupando um tempo precioso ao inspecionar amostras de diferentes alturas.



#### Gerenciador da intensidade de luz: Iluminação consistente

Durante a configuração inicial, é possível ajustar a intensidade de iluminação para corresponder à configuração específica do hardware do iluminador codificado e/ou do porta-objetivas codificado.





A intensidade de luz é ajustada automaticamente para produzir a imagem ideal ao trocar de aumento ou método de observação.

#### Operação simples e confortável

Gerenciador

de luz

O design de um sistema pode afetar sua eficiência de trabalho. Tanto sistemas independentes de microscopia quando os sistemas integrados ao software de análise de imagem PRECiV desfrutam dos benefícios de controles manuais convenientes que mostram claramente a posição do hardware. Os controles simples permitem que você mantenha o foco na amostra e na inspeção necessária.





Controlador manual para rotação do porta-objetivas motorizado

Controlador manual

# Funcionalidade para diversas tarefas de inspeção e análise

A série BX3M mantém métodos tradicionais de contraste da microscopia convencional, como campo claro, campo escuro, luz polarizada e contraste de interferência diferencial. Conforme novos materiais surgem, muitos dos problemas associados à detecção de defeitos utilizando métodos de contraste padrão podem ser resolvidos ao utilizar técnicas de microscopia avançadas, a fim de efetuar inspeções mais precisas e confiáveis. Novas técnicas de iluminação e opções de aquisição de imagem no software PRECiV de análise de imagem proporcionam mais opções para avaliar suas amostras e documentar os achados. Além disso, o microscópio BX3M também acomoda amostras maiores, mais pesadas e mais especializadas em comparação com os modelos convencionais.

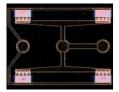
# Formação de imagem avançada

#### Observação MIX: O invisível torna-se visível

A tecnologia de observação MIX da série BX3M combina os métodos tradicionais de iluminação com a iluminação de campo escuro. Quando o deslizador MIX é usado, o seu anel de LEDs reflete campo escuro direcional sobre a amostra. Isso tem um efeito idêntico ao campo escuro tradicional, porém fornece a capacidade de selecionar um quadrante de LEDs para direcionar a luz a partir de diferentes ângulos. Essa combinação de campo escuro direcional e campo claro, fluorescência ou polarização, é conhecida por iluminação MIX, sendo particularmente útil para destacar defeitos e fazer a distinção entre superfícies elevadas e depressões.

#### Estrutura em wafer semicondutor

O padrão do circuito ntegrado não está claro.



Campo A cor do wafer

## Resíduo fotorresistente em um wafer semicondutor



Fluorescência

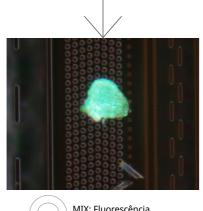


O resíduo

Condensador

MIX: Campo claro + campo escuro

A cor do wafer e o padrão do circuito integrado estão claramente representados



+ Campo escuro

O padrão do circuito integrado está claramente representado.

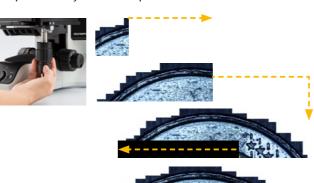
Ao unir imagens claras sem halo, é criada uma

Imagem composta de várias imagens com

campo escuro direcional de diferentes ângulos.

#### MIA instantâneo: Formação de imagem panorâmica fácil

Agora é possível unir imagens com facilidade e rapidez, movendo apenas os botões de ajuste XY na platina manual; não é necessária nenhuma platina motorizada. O software PRECiV™ utiliza reconhecimento de padrão para gerar uma imagem panorâmica, fornecendo aos usuários um campo de visão mais amplo em relação a um só quadro.





#### EFI: Crie imagens totalmente em foco

A função de imagem focal estendida (Extended Focus Imaging, EFI) no software PRECiV captura imagens de amostras cujas alturas vão além da profundidade de foco da objetiva, empilhando-as para criar uma só imagem totalmente focada. É possível executar a EFI utilizando um eixo Z manual ou motorizado, criando mapas de altura para uma visualização simples de estruturas. Além disso, também é possível criar uma imagem EFI no PRECiV Desktop em modo offline.





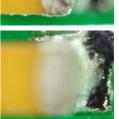




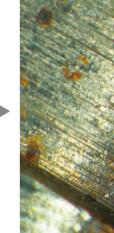
Imagem focal estendida de um capacitor em uma placa de circuito impresso

#### HDR: Áreas claras e escuras

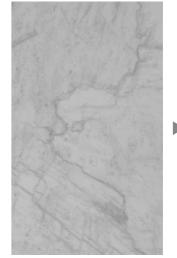
Imagem de uma moeda

Com o processamento avançado de imagem, a alta variação dinâmica (High dynamic range, HDR) ajusta as diferenças na claridade de uma imagem para reduzir o ofuscamento. O recurso de HDR aprimora a qualidade visual de imagens digitais, ajudando a gerar relatórios com um aspecto profissional.

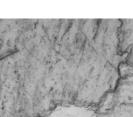


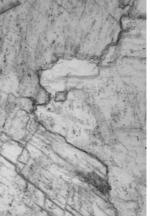


Regiões escuras e claras nitidamente expostas por HDR (amostra: lâmpada do injetor de combustível)



Melhoria do contraste por HDF





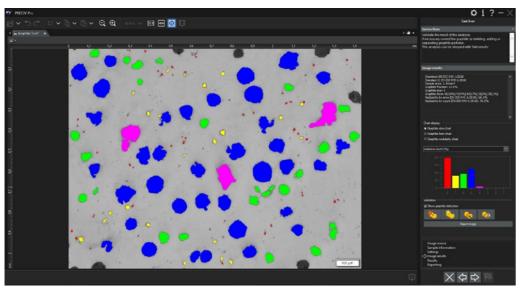
## Medição avançada

#### Medição básica ou de rotina

O software PRECiV disponibiliza diversas funções de medição para que o usuário obtenha facilmente dados úteis com base nas imagens. Para o controle de qualidade e a inspeção, frequentemente é necessário medir características nas imagens. Todos os níveis de licenças do PRECiV incluem funções interativas de medição, como distâncias, ângulos, retângulos, círculos, elipses e polígonos. Todos os resultados medidos são salvos com os arquivos de imagens para documentação complementar.

# Contagem e medição

A detecção de objetos e a medição de distribuição de tamanho estão entre as aplicações mais importantes na formação de imagens digitais. O software PRECiV incorpora um mecanismo de detecção que utiliza métodos de limiar para separar objetos de maneira confiável (por exemplo, partículas, arranhões) do plano de fundo.

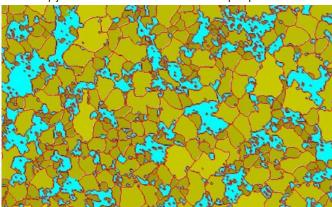


Contagem e medição

#### Soluções para a Ciência dos Materiais

O PRECiV™ oferece uma interface intuitiva e orientada ao processo de trabalho para a análise de imagens complexas.

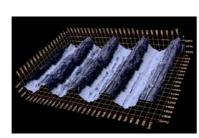
Com o simples clique de um botão, é possível executar as mais complexas tarefas de análise de imagens de maneira rápida, precisa e em conformidade com os padrões industriais mais comuns. Com uma redução significativa no tempo de processamento para tarefas repetitivas, os cientistas de materiais podem manter o foco na análise e na investigação. Os complementos modulares para inclusões e gráficos de intercepção são executados com facilidade a qualquer momento.



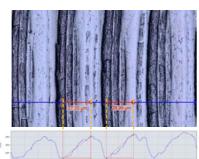
Solução planimétrica de dimensionamento de grãos com fase secundária

#### Medição de amostra 3D

Ao utilizar uma unidade externa de foco codificada ou motorizada, é possível capturar e exibir uma imagem EFI em 3D. Os dados de altura obtidos podem ser usados para medições 3D no perfil ou a partir da imagem de visualização única.



Visualização de superfície 3D (amostra do teste de rugosidade)



Visualização única e medição de perfil 3D

## Capacidade avançada de amostras

#### Visualização de mais tipos e tamanhos de amostra

A nova platina de 150 mm × 100 mm oferece um alcance mais longo na direção X do que os modelos anteriores. Em conjunto com o design de parte superior plana, essa nova platina permite a fácil colocação de amostras de grandes dimensões ou de múltiplas amostras na platina. A placa da platina tem orifícios roscados para acoplar suportes de amostra. A platina de maiores dimensões oferece flexibilidade aos usuários ao permitir a inspeção de um maior número de amostras através de um único microscópio, poupando espaço valioso no laboratório. O torque ajustável da platina facilita o posicionamento preciso sob alta ampliação com um campo de visão estreito.

#### Flexibilidade para a altura e peso de amostras

Amostras com até 105 mm (4,1 pol.) podem ser preparadas na platina com a unidade modular opcional. Graças ao mecanismo otimizado de focalização, o microscópio é capaz de acomodar um peso total (amostra + platina) de até 6 kg (13,2 lb). Isso significa que é possível inspecionar amostras de maiores dimensões e mais pesadas no microscópio BX3M, diminuindo o número de microscópios necessários no laboratório. Ao posicionar estrategicamente um suporte rotativo para wafers de 6 polegadas, os usuários poderão observar toda a superfície do wafer simplesmente rodando o suporte ao passarem pelo percurso de trajeto de 100 mm. O ajuste de torque da platina é otimizado para facilitar o seu uso e a pega confortável permite encontrar mais facilmente a região de interesse da amostra.

#### Flexibilidade para o tamanho da amostra

Quando as amostras são muito grandes para o posicionamento em uma platina tradicional de microscópio, é possível posicionar os componentes ópticos principais para microscopia de luz refletida em uma configuração modular. O sistema modular BXFM pode ser montado em um suporte maior usando um pilar ou em outro instrumento de preferência do usuário utilizando um suporte de montagem. Isso permite aos usuários se beneficiar da nossa célebre óptica, mesmo quando as suas amostras apresentam tamanhos ou formas exclusivas.



BX53MRF-S



#### Compatível com ESD: Proteja dispositivos eletrônicos contra descargas eletrostáticas

O BX3M tem uma capacidade de dissipação de descarga eletrostática (Electrostatic discharge, ESD) que protege os aparelhos eletrônicos da eletricidade estática causada por fatores humanos ou ambientais.

# Tradição em ópticas de última geração

Nossa tradição no desenvolvimento de ópticas de alta qualidade culminou em um histórico comprovado de qualidade óptica e de microscópios que oferecem uma excelente precisão na medição.

PV

#### Controle de aberração de ondas

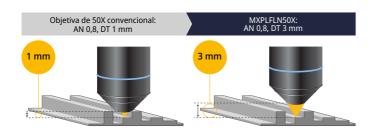
Ao usar um microscópio para pesquisa avançada ou integração de sistemas, é necessário padronizar o desempenho óptico para todas as objetivas. As nossas objetivas UIS2 vão além dos padrões convencionais de desempenho em termos de abertura numérica (AN) e distância de trabalho (DT), fornecendo controle de aberração de ondas que minimiza as aberrações responsáveis pela diminuição da resolução.

#### Combinação de abertura numérica alta e distância de trabalho longa

As lentes objetivas são essenciais para o desempenho de um microscópio. As objetivas MXPLFLN adicionam profundidade à série MPLFLN para formação de imagens de epi-iluminação, maximizando a abertura numérica e a distância de trabalho ao mesmo tempo. Resoluções mais altas em ampliações de 20X e 50X normalmente significam distâncias de trabalho mais curtas, o que obriga que a amostra ou a objetiva seja retraída durante a troca da objetiva. Em muitos casos, a distância de trabalho de 3 mm da série MXPLFLN elimina esse problema, possibilitando inspeções mais rápidas com menor chance de a objetiva tocar na amostra.

#### Iluminação de LED

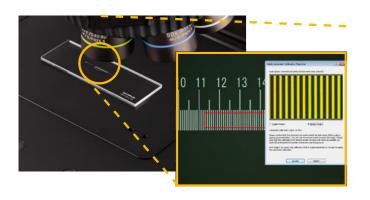
O BX3M utiliza fonte de luz com LED branco de alta intensidade para luz refletida e luz transmitida. O LED mantém uma temperatura de cor consistente independentemente da intensidade. Os LEDs oferecem uma iluminação eficiente e duradoura, ideal para inspecionar aplicações na área de Ciência dos Materiais.



Nome do modelo	AN	DT	Nome do modelo	AN	DT
MPLFLN20X	0,45	3,1 mm	MXPLFLN20X	0,6	3 mm
MPLFLN20XBD	0,45	3 mm	MXPLFLN20XBD	0,55	3 mm
MPLFLN50X	0,8	1 mm	MXPLFLN50X	0,8	3 mm
MPLFLN50XBD	0,8	1 mm	MXPLFLN50XBD	0,8	3 mm

#### Calibração automática

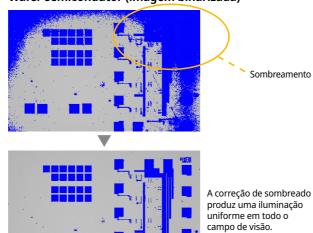
A calibração automática está disponível ao usar o software PRECiV™, assim como em microscópios digitais. A calibração automática elimina a variação humana nesse processo, promovendo medições mais confiáveis. A calibração automática usa um algoritmo que calcula automaticamente a calibração correta a partir de uma média de vários pontos de medição. Isso minimiza a variação causada por diferentes operadores e mantém uma precisão consistente, otimizando a confiabilidade para uma verificação regular.



#### Correção de sombreado

O software PRECiV oferece a correção de sombreado para acomodar o sombreado nos cantos de uma imagem. Quando usada com configurações de limite de intensidade, a correção de sombreado oferece uma análise mais precisa.

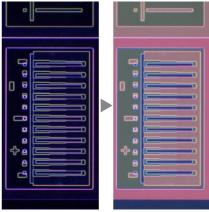
#### Wafer semicondutor (imagem binarizada)



#### **Aplicações**

A microscopia de luz refletida abrange diversas aplicações e setores. Abaixo temos apenas alguns exemplos do que pode ser obtido usando diferentes métodos de observação.

#### Campo escuro/MIX com campo claro Padrão do circuito integrado em um wafer semicondutor



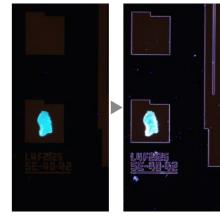
Campo escuro

MIX com campo claro

O campo escuro é utilizado para observar luz difusa ou difratada de uma amostra. Como apenas elementos não planos refletem essa luz, as imperfeições ficam claramente em destaque Os inspetores podem identificar até falhas ínfimas. O campo escuro é ideal para detectar arranhões e defeitos ínfimos em uma amostra e para examinar amostras com superfície espelhada, incluindo wafers.

 A função MIX de campo claro/campo escuro permite a observação do padrão do circuito integrado e da cor do wafer.

#### Fluorescência/MIX com campo escuro Resíduo fotorresistente em um wafer semicondutor



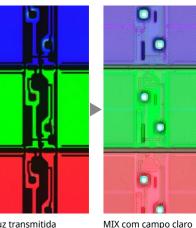
Fluorescência

MIX com campo escuro

Essa técnica é usada para amostras que fluorescem (emitem luz de um comprimento de onda diferente) quando iluminadas com um cubo de filtro especialmente projetado que pode ser selecionado para a aplicação específica.Ela é usada para inspecionar contaminação em wafers semicondutores, resíduos fotorresistentes e detectar fissuras com o uso de corante fluorescente.

 A função MIX de fluorescência/campo escuro viabiliza a observação do resíduo fotorresistente e do padrão do circuito integrado.

#### Luz transmitida/MIX com campo claro Filtro de cores LCD



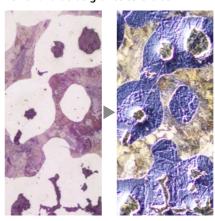
Luz transmitida

Essa técnica de observação é usada para amostras

transparentes, como LCDs, plásticos e materiais de vidro.

A função MIX de campo claro/luz transmitida permite a observação da cor do filtro e do padrão do circuito.

#### Ferro fundido de grafite esferoidal

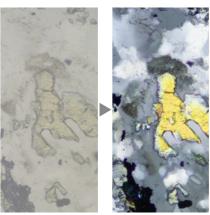


Campo claro

Contraste de interferência diferencial

O contraste de interferência diferencial (DIC) é uma técnica de observação na qual a altura de uma amostra, geralmente não detectável no campo claro, é visualizada como um relevo, semelhante a uma imagem 3D com contraste melhorado. É ideal para inspecionar amostras que possuem pequenas diferenças de altura, incluindo estruturas metalúrgicas e minerais.

#### Sericita

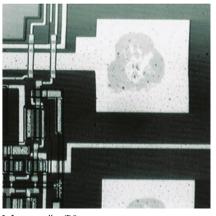


Campo claro

Esta técnica de observação microscópica usa a luz polarizada gerada por um conjunto de filtros (analisador e polarizador). As características da amostra afetam diretamente a intensidade da luz refletida pelo sistema. Ela é usada para estruturas metalúrgicas (ou seja, padrão de crescimento de grafite em ferro fundido nodular), minerais, LCDs e materiais semicondutores.

Luz polarizada

#### Seção de eletrodo



Infravermelho (IV)

A observação com IV é usada para inspeções não destrutivas de defeitos dentro de chips de circuitos integrados e outros dispositivos eletrônicos fabricados com silício ou vidro que transmite facilmente comprimentos de onda de luz IV.

s funções marcadas com este ícone exigem o software PRECiV.

# Escolha a configuração de acordo com sua necessidade

Seis sugestões de configuração do BX53M proporcionam flexibilidade para seleção do sistema que atenda suas necessidades da melhor maneira.

#### Uso geral Uso exclusivo Entry (Básica) Fluorescência Infravermelho Standard (Padrão) Advanced (Avançada) Projetado para observação Configuração fácil com Fácil de usar com Compatível com vários recursos Ideal para observação com infravermelha para inspeção recursos básicos avançados e exclusivos fluorescência aprimoramentos versáteis de circuitos integrados Microestrutura com grãos ferríticos (Refletido/DF) Fio de cobre da bobina (BF + DF/MIX) Filtro de cores LCD Resistência no padrão do circuito integrado "Padrão de circuito integrado com camadas de silício (FL + DF/MIX) (Transmitido/BF)

Polarização

Projetado para observar

características de birrefringência

Amianto

: Standard (Padrão)

: Opcional Estativa do microscópio Refletida ou refletida/transmitida Refletida ou refletida/transmitida Refletida Transmitida Método de observação R-BF: campo claro (refletida) Standard T-BF: campo claro (refletida/transmitida) T-BF (Padrão) DF: campo escuro DIC: contraste de interferência diferencial/polarização simples DF MIX: MIX FL: fluorescência IV: infravermelho POL: polarização

\* É possível usar T-BF ao selecionar a estativa do microscópio refletida/transmitida. DIC DIC MIX DIC MIX DIC Opcional Iluminador simples para alterar prontamente o tipo de análise Legenda da abertura para viabilizar a configuração correta de AS/FS Hardware codificado para restaurar facilmente as configurações Índice de escala de foco para encontrar o foco com rapidez Gerenciador da intensidade de luz para iluminação consistente Operação fácil e confortável com controlador manual Observação MIX para tornar o invisível visível Objetivas Selecione entre 3 conjuntos de níveis de objetiva com base em suas aplicações Objetivas para IV Objetivas para POL Selecione entre 3 conjuntos de níveis de objetiva com base em suas aplicações \*Para mais detalhes, consulte a tabela de especificação na página 25. Platina Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras Platina para POL

# Exemplos de configurações para Ciência dos Materiais

#### Combinação de luz refletida e luz refletida/transmitida do BX53M

Existem dois tipos de estruturas de microscópio na Série BX3M, um deles orientado somente para a luz refletida e o outro para a luz refletida e transmitida. Ambas as estativas podem ser configuradas com componentes manuais, codificadas ou motorizadas. As estativas são equipadas com capacidade contra descarga eletrostática (ESD) para a proteção de amostras eletrônicas.



Exemplo de configuração BX53MRF-S

Exemplo de configuração BX53MTRF-S

#### Combinação de IV do BX53M

As objetivas IV podem ser usadas em aplicações de inspeção, medição e processamento de semicondutores, em que é necessária a formação de imagens através de silício para visualizar o padrão. Também oferecemos as objetivas infravermelhas (IV) 5X a 100X com correção de aberração cromática nos comprimentos de onda de luz visível até o infravermelho próximo. Para trabalhos de alta ampliação, a rotação do colar de correção da série de lentes LCPLN-IR corrige as aberrações causadas pela espessura da amostra. Uma só objetiva proporciona a obtenção de uma imagem nítida.

Objetivas	Objetivas Ampliações AN DT		DT(mm)	Espessura do vidro de proteção (mm)	Espessura do silício (mm)	Resolução*¹ (µm)
LMPLN-IR*2	5X	0,10	23	0-0,17	_	6,71* <sup>3</sup>
	10X	0,30	18	0-0,17	_	2,24* <sup>3</sup>
LCPLN-IR*2	LCPLN-IR*2 20X 0,45 8,3		0-1,2	0-1,2	1,49* <sup>3</sup>	
	LCPLN-IR*2 50X 0,65 4,5		0-1,2	0-1,2	1,03* <sup>3</sup>	
	100X 0,85 1,2		0-0,7	0-1,0	0,79* <sup>3</sup>	

<sup>\*1</sup> Resoluções calculadas com o diafragma da íris de abertura totalmente aberto







sem correção

#### Combinação de luz polarizada do BX53M

A óptica de luz polarizada do BX53M oferece aos geólogos as ferramentas certas para a formação de imagens de luz polarizada de alto contraste. Aplicações como identificação mineral, investigação de caraterísticas ópticas de cristais e observação de seções de rocha sólida obtêm benefícios da estabilidade do sistema e do meticuloso alinhamento óptico.

#### Lentes Bertrand para observações conoscópicas e ortoscópicas

Com um acessório de observação conoscópica U-CPA, a comutação entre a observação ortoscópica e conoscópica é rápida e simples. O equipamento tem ajuste de foco para uma visualização clara dos padrões de interferência do plano focal posterior. O limitador de campo visual Bertrand torna possível a captura consistente de imagens conoscópicas claras e nítidas.



Acessórios de luz polarizada



Configuração ortoscópica do BX53M



Configuração conoscópica/ ortoscópica do BX53M

#### Ópticas livres de tensão

Graças à nossa sofisticada tecnologia de design e fabricação, as objetivas livres de tensão UPLFLN-P reduzem a tensão interna ao mínimo. Isso resulta em um valor de EF mais alto, proporcionando um excelente contraste na imagem.

AN

0.13

0,30

0,50

0,75

1,30

AN

0,10

AN

0,25

0,40

0,65

1,25

Série UPLFLN-P

Obietivas

UPLFLN 4XP

UPLFLN 10XP

**UPLFLN 20XP** 

UPLFLN 40XP

PLN-P\*

Objetivas

PLN 4XP

Obietivas

ACHN 10XP

ACHN 20XP

ACHN 40XP

ACHN 100XOP

UPLFLN 100XOP

Série ACHN-P\*



Objetivas UPLFLN-P sem cepa

17.0 mm

10 0 mm

2.1 mm

0,51 mm

0,2 mm

18,5 mm

6,0 mm

3,0 mm

0.45 mm

0,13 mm

DT

DT

## Uma grande variedade de compensadores e lâminas de onda

Cinco compensadores diferentes estão disponíveis para medir a birrefringência em cortes finos de rochas e minerais. O nível de retardo de medição varia de 0 a 20 λ. Para medições mais simples e contrastes de imagens mais



altos, é possível usar os compensadores Berek e Senarmont, que alteram o nível de retardo em todo o campo de visão.

Intonvalo	de medicão	doc compo	ncadoros
THILE VAIO	ue illeultat	, uos comb	: II Sauui es

intervalo de medição dos compensadores					
Compensador	Intervalo de medição	Aplicações			
Berek espesso (U-CTB)	0/11.000 nm (20 λ)	Medição de alto nível de retardo (R*>3 λ), (cristais, macromoléculas, fibra etc.)			
Berek (U-CBE)	0/1640 nm (3 λ)	Medição de nível de retardo (cristais, macromoléculas, organismos vivos etc.)			
Compensador Senarmont (U-CSE)	0/546 nm (1 λ)	Medição de nível de retardo (cristais, organismos vivos etc.) Melhoria de contraste da imagem (organismos vivos etc.)			
Compensador Brace-Koehler 1/30 \(\lambda\) (U-CBE2)	0/20 nm (1/30 λ)	Medição do contraste da imagem (organismos vivos etc.)			
Compensador de quartzo (U-CWE2)	500/2200 nm (4 λ)	Medição aproximada de nível de retardo (cristal, macromoléculas etc.)			
*R = nível de retardo					

o filtro de interferência 45-IF546

## Sistema BXFM

\*Limitado a até FN 22, incompatível com FN 26.5

O sistema BXFM pode ser adaptado a aplicações especiais ou integrado a outros instrumentos. A construção modular oferece uma adaptação simples a ambientes e configurações exclusivos com uma variedade de pequenos iluminadores especiais e suportes de fixação.



<sup>\*2</sup> Limitado a até FN 22, incompatível com FN 26,5

<sup>\*3</sup> Com uso de 1100 nm

# Design modular: Crie um sistema da sua maneira

#### Estativas de microscópio

Existem duas estativas de microscópio para luz refletida; uma delas também tem capacidade de luz transmitida. A fim de acomodar amostras mais altas, também há um adaptador para elevar o iluminador.

	Poss	ível Luz refletida	Luz transmitida	Altura da amostra
1	BX53MRF-S			0-65 mm
2	BX53MTRF-S			0-35 mm
1, 3	BX53MRF-S + BX3M-ARMAD			40-105 mm
2, 3	BX53MTRF-S + BX3M-ARMAD			40-75 mm

#### Acessórios convenientes para utilização em microscopia.

-	HP-2	Prensa manual	
-	COVER-018	Proteção contra poeira	



#### **Suportes**

Para aplicações de microscopia nas quais a amostra não se adapta à platina, é possível montar o iluminador e as ópticas em um suporte maior ou em outro equipamento.

#### Configuração do iluminador BXFM + BX53M

_	1	BXFM-F	A interface da estativa pode ser montada em suporte para parede/ pilar de 32 mm		
	2	- BX3M-ILH	Suporte do iluminador		
	3	BXFM-ILHSPU	Mola do contador para o BXFM		
_	6	SZ-STL	Suporte grande		

#### Configuração do iluminador BXFM + U-KMAS

1	BXFM-F	A interface da estativa pode ser montada em suporte para parede/ pilar de 32 mm			
4	BXFM-ILHS	Suporte U-KMAS			
5	SZ-STL	Suporte grande			



#### **Tubos**

Para imagens microscópicas com oculares ou para observação da câmera, selecione os tubos por tipo de imagem e postura do operador durante a observação.

1         U-TR30-2         22         Trinocular         Fixo         Inversa         1           2         U-TR30IR         22         Trinocular para IV         Fixo         Inversa         1           3         U-ETR-4         22         Trinocular         Fixo         Ereta         —           4         U-TTR-2         22         Trinocular         Inclinável         Inversa         —           5         U-SWTR-3         26,5         Trinocular         Fixo         Inversa         —			FN	Tipo	Tipo de ângulo	Imagem	Número de mecanismos de ajuste de dioptria
3 U-ETR-4 22 Trinocular Fixo Ereta — 4 U-TTR-2 22 Trinocular Inclinável Inversa —	1	U-TR30-2	22	Trinocular	Fixo	Inversa	1
4 U-TTR-2 22 Trinocular Inclinável Inversa —	2	U-TR30IR	22	Trinocular para IV	Fixo	Inversa	1
	3	U-ETR-4	22	Trinocular	Fixo	Ereta	_
5 U-SWTR-3 26,5 Trinocular Fixo Inversa —	4	U-TTR-2	22	Trinocular	Inclinável	Inversa	
	5	U-SWTR-3	26,5	Trinocular	Fixo	Inversa	
6 U-SWETTR-5 26,5 Trinocular Inclinável Ereta —	6	U-SWETTR-5	26,5	Trinocular	Inclinável	Ereta	
7 U-TLU 22 Porta única — — —	7	U-TLU	22	Porta única	_	_	_
8 U-SWATLU 26,5 Porta única — — —	8	U-SWATLU	26,5	Porta única	_	_	



#### **Iluminadores**

O iluminador projeta luz para a amostra com base no método de observação selecionado. Interfaces de software com iluminadores codificados para ler a posição dos cubos e reconhecer automaticamente o método de observação.



	Possível	Função codificada	Fonte de luz	BF	DF	DIC	POL	IV	FL	MIX	AS/FS
1	BX3M-RLAS-S	Posição fixa de 3 cubos	LED – integrado								
			LED								
2	BX3M-URAS-S	Posição afixável de 4 cubos	Lâmpada de halogênio								
			Mercúrio/guia de luz								
			LED								
3	BX3M-RLA-S		Lâmpada de halogênio								
4	BX3M-KMA-S		LED – integrado								
5	BX3-ARM	Braço mecânico para luz transmitida									
	U-KMAS		LED								
6			Lâmpada de halogênio								

#### Fontes de luz

Fontes de luz e fontes de alimentação para iluminação de amostras: selecione a fonte de luz apropriada para o método de observação.

#### Configuração padrão da fonte de luz de LED

1	BX3M-LEDR	Caixa da lâmpada LED para luz refletida				
2	U-RCV	Conversor DF para o BX3M-URAS-S, exigido para observação com DF, se necessário				
3	BX3M-PSLED	Fonte de alimentação para a caixa da lâmpada LED, requer o sistema BXFM				
4	BX3M-LEDT	Caixa da lâmpada LED para luz transmitida				
Configuração de fonte de luz de fluorescência						

#### onfiguração de fonte de luz de fluorescência

5	Ų-LLGAD	Adaptador de guia de luz		
2	U-RCV	Conversor DF para o BX3M-URAS-S, exigido para observação com DF, se necessário		
6	Ų-LLG150	Guia de luz, comprimento: 1,5 m (4,9 pés)		
7	L <sub>U-LGPS</sub>	Fonte de luz para fluorescência		
8, 9	Ų-LH100HG (HGAPO)	Caixa da lâmpada de mercúrio para fluorescência		
2	U-RCV	Conversor DF para o BX3M-URAS-S, exigido para observação com DF, se necessário		
10	U-RFL-T	Fonte de alimentação para lâmpada de mercúrio de 100 W		

#### Configuração de fonte de luz de lâmpada de halogênio e lâmpada de halogênio IV

	11	Ų-Lŀ	100IR	Caixa da lâmpada de halogênio para IV
-	12		U-RMT	Cabo extensor para a caixa da lâmpada de halogênio, cabo com 1,7 m (5,6 pés) (requer extensão de cabo, se necessário)
	13, 14	L.	TH4-100 (200)	Especificação da fonte de alimentação de 100 V (200 V) para lâmpada de halogênio de 100 W/50 W
	15		TH4-HS	Controlador manual para intensidade de luz de lâmpada de halogênio (regulador de intensidade TH4-100 (200) sem controlador manual)



#### Porta-objetivas

Acessório para objetivas e deslizadores. Selecione pelo número e tipo de objetivas necessárias; também com/sem acessório deslizador.

	possível	Tipo	Orifícios	BF	DF	DIC	MIX	ESD	Número de orifícios centrais
1	P4RE	Manual	4						4
2	U-5RE-2	Manual	5						
3	U-5RES-ESD	Codificada	5						
4	U-D6RE	Manual	6						
5	U-D6RES	Codificada	6						
6	U-D5BDREMC	Motorizada	5						
7	U-D6BDRE	Manual	6						
8	U-D5BDRES-ESD	Codificada	5						
9	U-D6BDRES-S	Codificada	6						
10	U-D6REMC	Motorizada	6						
11	U-D6BDREMC	Motorizada	6						
12	U-D5BDREMC-VA	Motorizada	5						



#### Deslizadores

Selecione o deslizador para complementar a observação de campo claro tradicional. O deslizador DIC fornece informações topográficas sobre a amostra com opções para maximizar o contraste ou a resolução. O deslizador MIX fornece flexibilidade de iluminação com uma fonte LED segmentada na trajetória do campo escuro.

#### Deslizador DIC

		Tipo	Quantidade de cisalhamento	Objetivas disponíveis		
1	U-DICR	Standard (Padrão)	Média	MPLFLN*, MPLFLN-BD**, LMPLFLN, LMPLFLN-BD, MXPLFLN, MXPLFLN-BD, MPLAPON, LCPLFLN-LCD		
Deslizad	or MIX					
			Objetivas disponíveis			
2 U-MIXR-2 N			MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD, MPLN-BD, MXPLFLN-BD			
Cabo						
- U-MIXRCBL***			Cabo do U-MIXR, compr	Cabo do U-MIXR, comprimento do cabo: 0,5 m (1,6 pés)		
*1.25X e 2.5	X não estão d	isponíveis, **2.5	X não está disponível, ***Apenas MIX	R		

#### Caixas de controle e controladores manuais

Caixas de controle para possibilitar a interface do hardware do microscópio com um PC e controladores manuais para a exibição e controle do hardware.

#### Configuração do BX3M-CB (CBFM)

•	Jonnigai	aração do BASIM EB (EBTIM)						
1		BX3M-CB	Caixa de controle para o sistema BX53M					
	2	BX3M-CBFM	Caixa de controle para o sistema BXFM					
	3	- BX3M-HS	Controle de observação MIX, indicador de hardware codificado, botão de função programável do software (PRECiV)					
	4	BX3M-HSRE	Rotação do porta-objetivas motorizado					

-		Cabo do porta-objetivas motorizado, comprimento do cabo: 0,2 m (0,7 pés)
---	--	--





#### **Platinas**

Platinas e placas de platinas para posicionamento de amostras. Selecione com base na forma e tamanho da amostra.

#### Configuração da platina de 150 mm × 100 mm

1	Ų-SĮC64	Platina com haste superior de superfície plana de 150 mm × 100 mm
2	U-SHG (T)	Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
3	U-SP64	Placa de platina para U-SIC64
4	Ų-WHP64	Placa de wafer para U-SIC64
5	BH2-WHR43	Suporte para wafer de 4–3 pol.
6	BH2-WHR65	Suporte para wafer de 6-5 pol.
7	U-SPG64	Placa de vidro para U-SIC64

#### Configuração da platina de 100 mm × 100 mm

8	Ų-SICR2	Platina com haste direita de 105 mm × 100 mm
9	U-MSSP4	Placa de platina para U-SIC4R2
10	Ų-WHP2	Placa de wafer para U-SIC4R2
5	BH2-WHR43	Suporte para wafer de 4–3 pol.
11	U-MSSPG	Placa de vidro para U-SIC4R2

#### Configuração da platina de 76 mm × 52 mm

12	Ų-SVRM	Platina com haste direita de 76 mm × 52 mm
2	U-SHG (T)	Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
13	U-MSSP	Placa de platina para U-SVR M
14, 15	U-HR (L) D-4	Suporte fino de lâminas para a abertura direita (esquerda)
16, 17	U-HR (L) DT-4	Suporte de lâminas espessas para a abertura direita (esquerda), para pressionar o vidro da lâmina contra a superfície superior da platina, quando a amostra é difícil de levantar

Outros							
18	U-SRG2	Platina giratória					
19	Ų-SRP	Platina giratória para POL, pode ser parada a 45° a partir de qualquer posição					
20	U-FMP	Platina mecânica para U-SRP/U-SRG2					

#### Adaptadores de câmera

Adaptadores para observação de câmera. Selecionável a partir do campo de visão e ampliação necessários. O alcance de observação real pode ser calculado usando esta fórmula: campo de visão real (diagonal em mm) = campo de visão (número de visão) ÷ ampliação da objetiva.

		Ajuste de	centralização da ampliação	Área de imagem do CCD (número de campo) (mm)		
			(mm)	2/3 pol.	1/1,8 pol.	1/2 pol.
1	U-TV1X-2 com U-CMAD3	1	_	10,7	8,8	8
2	U-TV1XC	1	ø2	10,7	8,8	8
3	U-TV0.63XC	0,63	_	17	14	12,7
4	U-TV0.5XC-3	0,5	_	21,4	17,6	16
5	U-TV0.35XC-2	0,35	_	_	_	22

Para Informações sobre câmeras digitais, acesse nosso site: http://www.olympus-ims.com/en/microscope/dc/

#### **Oculares**

Ocular para visualização direta no microscópio. Selecione com base no campo de visão pretendido.

	: possível	FN (mm)	Mecanismo de ajuste de dioptria	Retículo cruzado integrado
1	WHN10X	22		
2	WHN10X-H	22		
3	CROSS WHN10X	22		
4	SWH10X-H	26,5		
5	CROSS SWH10X	26,5		







#### Filtros ópticos

Os filtros ópticos convertem a luz de exposição da amostra em vários tipos de iluminação. Selecione o filtro apropriado para os requisitos de observação.

#### BF, DF, FL

1, 2	U-25ND25, 6	Filtro de densidade neutra, transmissão 25%, 6%
3	U-25LBD	Filtro de cores tipo Daylight
4	U-25LBA	Filtro de cores de lâmpada de halogênio
5	U-25IF550	Filtro verde
6	U-25L42	Filtro de bloqueio UV
7	U-25Y48	Filtro amarelo
8	U-25FR	Filtro azul (necessário para o BX3M-URAS-S)

# POL, DIC 9 U-AN-2 A direção da polarização é fixa 10 U-AN360-3 A direção da polarização é giratória 11 U-AN360P-2 A direção da polarização de alta qualidade é giratória 12 U-PO3 A direção da polarização é fixa 13 45-IF546 Filtro verde de ø45 mm para POL

	15 11 5 10	That of terial all bis initi para i of
Outros		
20	U-25	Filtro vazio, para utilizar com outros filtros de ø25 mm do usuário



IV		
14	U-AN360IR	A direção da polarização IV é giratória (reduz o halo na observação de IV ao utilizar em combinação com U-AN360IR e U-POIR)
15	U-POIR	A direção da polarização IV é fixa
16	U-BP1100IR	Filtro passa-baixa: 1100 nm
17	U-BP1200IR	Filtro passa-baixa: 1200 nm

-	Luz trans	smitida	
	18	43IF550-W45	Filtro verde de ø45 mm
	19	U-POT	Filtro polarizador
			ANI - DO TESTE TESTE TO THE TES

#### Condensadores

Os condensadores coletam e focam a luz transmitida. Utilize para a observação de luz transmitida.

1	U-AC2	Condensador Abbe (disponível para objetivas de 5X e superiores)
2	U-SC3	Condensador Swing-out (disponível para objetivas de 1,25X e superiores)
3	U-LWCD	Condensador de longa distância de trabalho para placas de vidro (U-MSSPG, U-SPG64)
4	U-POC-2	Condensador swing-out para POL



#### Unidades de espelho

Unidade de espelho para o BX3M-URAS-S. Selecione a unidade para a observação necessária.

1	U-FBF	Para BF, filtro ND removível
2	U-FDF	Para DF
3	U-FDICR	Para POL, a posição dos nicóis cruzados é fixa
4	U-FBFL	Para BF, filtro ND integrado (é necessário usar BF* e FL)
5	U-FWUS	Para FL ultravioleta: BP330-385 BA420 DM400
6	U-FWBS	Para FL azul: BP460-490 BA520IF DM500
7	U-FWGS	para FL verde: BP510-550 BA590 DM570
8	U-FF	Unidade de espelho vazia





#### \*Apenas para iluminação episcópica coaxial

#### **Tubos intermediários**

Vários tipos de acessórios para múltiplas finalidades. Para usar entre o tubo e o iluminador.

1	U-CA	Seletor de ampliação (1X, 1,25X, 1,6X, 2X)
2	U-TRU	Unidade trinocular intermediária



#### **Objetivas UIS2**

As objetivas ampliam a amostra. Selecione a objetiva correspondente à distância de trabalho, poder de resolução e método de observação para a aplicação.

Objetivas		Ampliações	AN	DT(mm)	Espessura do vidro de proteção*3 (mm)	Resolução*4 (µm)
MPLAPON	1 2	50X 100X	0,95 0,95	0,35 0,35	0	0,35 0,35
MXPLFLN	3 4	20X 50X	0,6 0,8	3	0	0,56 0,42
MPLFLN	5 6 7 8 9 10 11	1,25X*5*6 2,5X*6 5X 10X 20X 40X*2 50X 100X	0,04 0,08 0,15 0,30 0,45 0,75 0,80 0,90	3,5 10,7 20,0 11,0 3,1 0,63 1,0	0/0,17 0/0,17 0/0,17 0/0,17 0 0 0	8,39 4,19 2,24 1,12 0,75 0,45 0,42 0,37
SLMPLN	13 14 15	20X 50X 100X	0,25 0,35 0,60	25 18 7,6	0/0,17 0 0	1,34 0,96 0,56
LMPLFLN	16 17 18 19 20	5X 10X 20X 50X 100X	0,13 0,25 0,40 0,50 0,80	22,5 21,0 12,0 10,6 3,4	0/0,17 0/0,17 0 0 0	2,58 1,34 0,84 0,67 0,42
MPLN*5	21 22 23 24 25	5X 10X 20X 50X 100X	0,10 0,25 0,40 0,75 0,90	20,0 10,6 1,3 0,38 0,21	0/0,17 0/0,17 0 0 0	3,36 1,34 0,84 0,45 0,37
LCPLFLN/LCD	26 27 28	20X 50X 100X	0,45 0,70 0,85	8,3/7,4 3,0/2,2 1,2/0,9	0/1,2 0/1,2 0/0,7	0,75 0,48 0,39
MXPLFLN-BD	29 30	20X 50X	0,55 0,80	3 3	0	0,61 0,42
MPLFLN/BD*7	31 32 33 34 35 36 37	2,5X 5X 10X 20X 50X 100X 150X	0,08 0,15 0,30 0,45 0,80 0,90	8,7 12,0 6,5 3,0 1,0 1,0	0/0,17 0/0,17 0 0 0 0	4,19 2,24 1,12 0,75 0,42 0,37 0,37
MPLFLN/BDP*7	38 39 40 41 42	5X 10X 20X 50X 100X	0,15 0,25 0,40 0,75 0,90	12,0 6,5 3,0 1,0	0/0,17 0/0,17 0 0 0	2,24 1,34 0,84 0,45 0,37
LMPLFLN/BD*7	43 44 45 46 47	5X 10X 20X 50X 100X	0,13 0,25 0,40 0,50 0,80	15,0 10,0 12,0 10,6 3,3	0/0,17 0/0,17 0 0 0	2,58 1,34 0,84 0,67 0,42
MPLN/BD*5*7*8	48 49 50 51 52	5X 10X 20X 50X 100X	0,10 0,25 0,40 0,75 0,90	12,0 6,5 1,3 0,38 0,21	0/0,17 0/0,17 0 0 0	3,36 1,34 0,84 0,45 0,37
MPLAPON2		100X Óleo*1	1,45	0,1	0	0,23





- \*1 Óleo especificado: IMMOIL-F30CC/IMMOIL-8CC/IMMOIL-500CC/IMMOIL-F30CC
- \*2 A objetiva MPLFLN40X não é compatível com a microscopia de contraste de interferência diferencial
- \*3 0: Para visualizar amostras sem vidro de proteção
- \*4 Resoluções calculadas com o diafragma da íris de abertura totalmente aberto
- \*5 Limitado até FN 22, sem conformidade com FN 26,5
- \*6 O analisador e o polarizador são recomendados para uso com MPLFLN1.25X e 2.5X
- \*7 BD: objetivas de campo claro/campo escuro
- \*8 Pode ocorrer uma leve vinheta na periferia do campo quando as objetivas da série MPLN-BD são usadas com fontes de luz de alta intensidade, como mercúrio e xênon, para observação de campo escuro

#### ■ Definição de abreviações de lentes objetivas

## M P L (Plano) F L N 1 0 0 B D

M: metalúrgica (sem tampa)
MX: alta abertura numérica e
longa distância de trabalho
para uso metalúrgico
LM: longa distância de trabalho
para uso metalúrgico

SIM: distância de trabalho

para uso metalurgico

LM: longa distância de trabalh
para uso metalúrgico

SLM: distância de trabalho
superlonga para uso
metalúrgico

LC: observação através do

curvatura do campo da periferia do plano da imagem

PL: Plano/Corrige a

Nenhum: Acromática/Corrige a aberração em dois comprimentos de onda de azul e vermelho FL: Semiapocromática/Corrige a aberração cromática na faixa visível (violeta a vermelho)

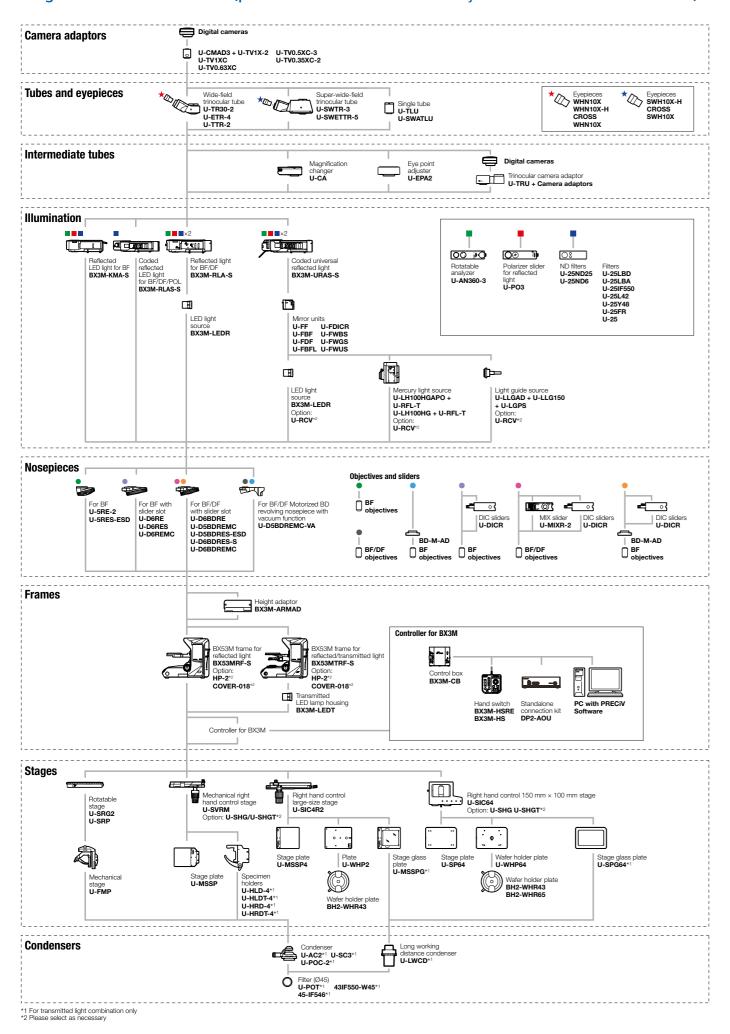
vermelho)

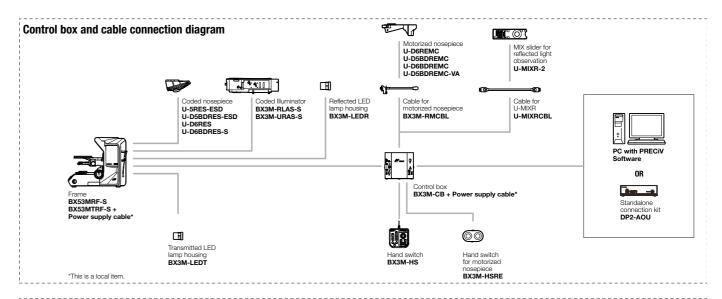
O: Apocromática/Corrige de forma ideal a aberração cromática em toda a banda visível (violeta a vermelho)

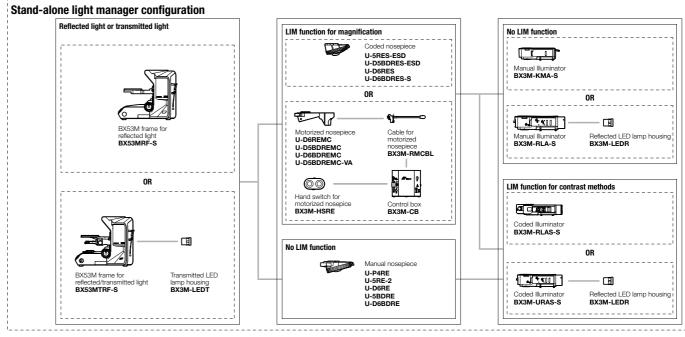
**Número:** ampliação da lente objetiva Nenhum: campo claro
BD: campo claro/
campo escuro
BDP: Campo claro/campo
escuro/ polarização
IV: IV
LCD: LCD

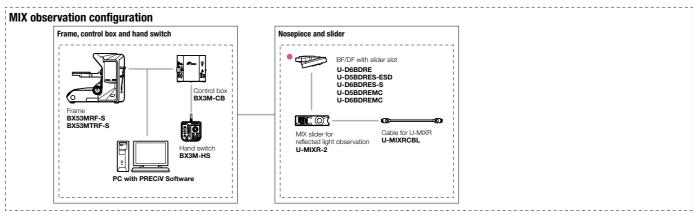
20

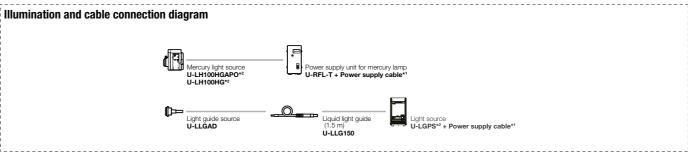
### Diagrama do sistema BX53M (para a luz refletida e a combinação de luz refletida/transmitida)







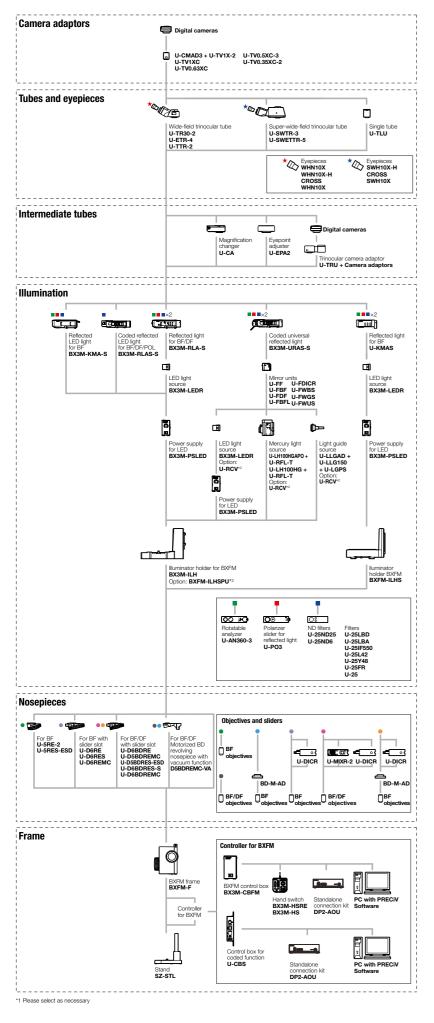


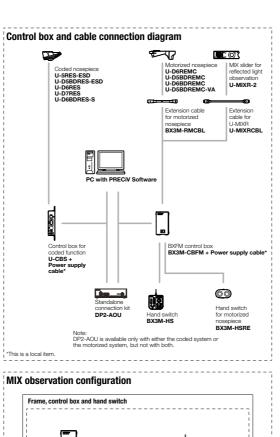


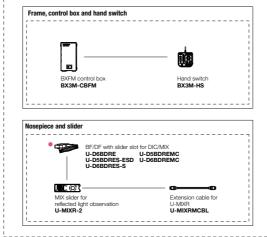
\*1 This is a local item.
\*2 Bulbs are required for these light sources.

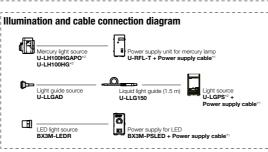
Linuis and requireur for a lease right, sources.

### Diagrama do sistema BXFM



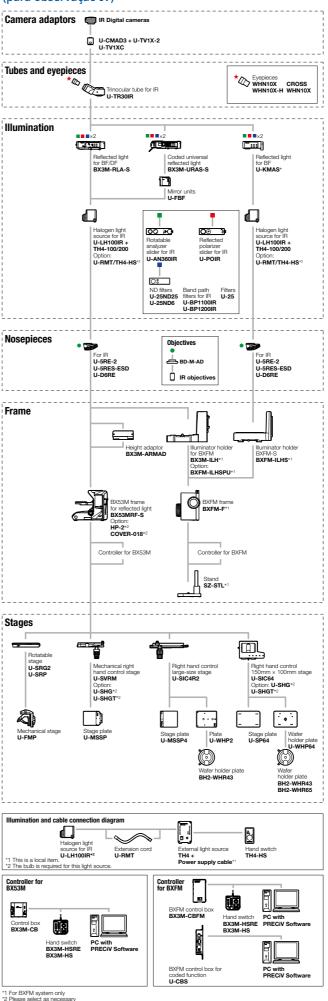




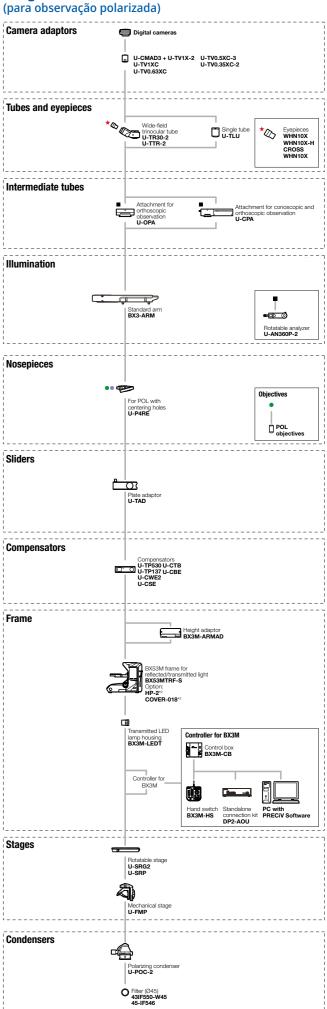


This is a local item.
 Bulbs are required for these light sources.

# Diagrama do sistema BX53M (para observação IV)



# Diagrama do sistema BX53M (para observação polarizada)



24

# **Especificações**

Estativa do microscópio  Tubo de observação  Iluminação  Revólver porta-objetivas c	Foco  Altura máx. da amostra  Campo amplo (FN 22)  Luz refletida  Luz transmitida  giratório	Sistema óptico UIS2 (corrigid 8X53MRF-S (Refletida) Percurso: 25 mm Traço fino por rotação: 100 µ Regulação mínima: 1 µm Com limite macrométrico su Refletida: 65 mm (sem espaç. Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinoculai 8X3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz	BXS3MTRF-S ((Refletida/transmitida)  m  perior, ajuste de torque para ador), 105 mm (com o BX3M (sem espaçador), 75 mm (c  FS, AS ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	M-ARMAD) com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S	BXS3MTRF-S (Refletida/transmitida)  DF/DIC/POL/MIX FS, AS (com m	BX53MRF-S (Refletida)				
Tubo de observação iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Altura máx. da amostra Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	(Refletida) Percurso: 25 mm Traço fino por rotação: 100 µ Regulação mínima: 1 µm Com limite macrométrico su Refletida: 65 mm (sem espaç Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinoculai BX3M-KMA-5 LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliza)	(Refletida/transmitida)  m  perior, ajuste de torque para ador), 105 mm (com o BX3M (5em espaçador), 75 mm (com o BX3M (5em espaçador), 75 mm (com o BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	(Refletida)  a botão macro  A-ARIMAD)  com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S	(Refletida/transmitida)  OF/DIC/POL/MIX FS, AS (com m	(Refletida)	(Refletida/transmitida)			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Altura máx. da amostra Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	Traço fino por rotação: 100 µ Regulação mínima: 1 µm Com limite macrométrico su Refletida: 65 mm (sem espa; Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinocular BX3M-KMAS LED branco, BF/DIC/POUMIX (com mecanismo de centraliz	perior, ajuste de torque para ador), 105 mm (com o BX3M (sem espaçador), 75 mm (c r.FS, AS ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	M-ARMAD) com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S		ecanismo de centralização), in	1			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Altura máx. da amostra Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	Regulação mínima: 1 µm  Com limite macrométrico suj Refletida: 65 mm (sem espac, Refletida/transmitida: 35 mm  U-TR30-2 invertido: trinoculat BX3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz  —  U-SRE-2	perior, ajuste de torque para ador), 105 mm (com o BX3M (sem espaçador), 75 mm (c r.FS, AS ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	M-ARMAD) com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S		ecanismo de centralização), in	1			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Altura máx. da amostra Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	Com limite macrométrico su Refletida: 65 mm (sem espaç Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinoculai BX3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz	ador), 105 mm (com o BX3M (sem espaçador), 75 mm (c FS, AS acção), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	M-ARMAD) com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S		ecanismo de centralização), in	1			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	Refletida: 65 mm (sem espaç Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinocular BX3M-KMA-5 LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz	ador), 105 mm (com o BX3M (sem espaçador), 75 mm (c FS, AS acção), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	M-ARMAD) com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S		ecanismo de centralização), in	1			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Campo amplo (FN 22) Luz refletida Luz transmitida	Refletida/transmitida: 35 mm U-TR30-2 invertido: trinoculai BX3M-KMA-5 LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centralizi	r (sem espaçador), 75 mm (c FS, AS ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	com o BX3M-ARMAD)  BX3M-RLAS-S		ecanismo de centralização), in	1			
iluminação Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Luz refletida Luz transmitida	BX3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz —	FS, AS ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de			ecanismo de centralização), in	1			
Revólver porta-objetivas <u>c</u>	Luz transmitida	LED branco, BF/DIC/POL/MIX (com mecanismo de centraliz  —  U-SRE-2	ação), interbloqueio BF/DF BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de			ecanismo de centralização), in	1			
Revólver porta-objetivas <u>c</u>		U-SRE-2	BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de	_	DV2M LEDT					
	giratório				BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de trabalho	_	BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de traball			
	,,,aco.no		trabalho	U-D6BDRE	longa distancia de dabanio		U-D6BDRES-S			
Ocular (FN 22)		Para BF: quíntuplo		Para BF/DF: sêxtuplo			Para BF/DF: sêxtuplo, codi			
<u> </u>		WHN10X WHN10X-H								
Observação MIX		— U-MIXR-2 Deslizador MIX para					Caixa de controle BX3M-HS Controlador manual U-MIXR-2 Deslizador MIX para observação de luz refletic U-MIXRCBL Cabo para MIXR			
Condensador (longa distâ	ncia de trabalho)	-	U-LWCD	_	U-LWCD	_	U-LWCD			
Cabo de alimentação		UYCP (x1)					UYCP (x2)			
Peso		Refletida/transmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 lb) (estativa do microscópio: 7,6 kg (16,8 lb))								
Conjunto MPLFLN		-	00X	-		_				
Conjunto MPLFLN BD		Observação BF/DF/DIC/POL/FL MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD								
Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD		1 -								
		MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD								
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD						20XBD, 50XBD, 100XBD				
Conjunto de 76 mm × 52 ı	mm	Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) × 52 mm (Y), com ajuste de torque  U-SVRM, U-MSSP								
Conjunto de 100 mm × 10	0 mm	Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y U-SIC4R2, U-MSSP4								
Conjunto de 100 mm × 10	0 mm (G)	Platina com haste direita coa U-SIC4R2, U-MSSPG	xial de grandes dimensões/	/100 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)						
Conjunto de 150 mm × 10	0 mm	Platina com haste direita coa U-SIC64, U-SHG, U-SP64	xial de grandes dimensões/	150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y						
Conjunto de 150 mm × 10	0 mm (G)	Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro) U-SIC64, U-SHG, U-SPG64								
Continue de 1	- A 470/±	DVOLG CD DVCCC CC	VD 2 11 147V2-221							
	0 MIX*		XK-2, U-MIXRCBL							
DIC*										
			IDD HAFIDA HAFYIA	II ANIZO 2 II ANIZOS 5	DO3 11 3515550 11 351 12 11	1 35 11 3550				
Filtros			LBD, U-ZSLBA, U-25Y48,	U-AN360-3, U-AN360P-2, U-	rus, u-2511550, U-25L42, U	J-23, U-25FK				
	ſ	· ·	12 WILDER 11 WILDS 2112	2 WILIDA2						
				Z-WHK43						
			1-4, U-HLD1-4			U-HRD-4, U-HRDT-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4				
Co C	ondensador (longa distă abo de alimentação eso onjunto MPLFLN BD onjunto MPLFLN-BD, LM PLFLN-BD, MXPLFLN-BD onjunto de 76 mm × 52 maiunto de 100 mm × 10 onjunto de 100 mm × 10 onjunto de 150 mm × 10	ondensador (longa distância de trabalho) abo de alimentação esso onjunto MPLFLN onjunto MPLFLN BD onjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD onjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD onjunto de 76 mm × 52 mm onjunto de 100 mm × 100 mm onjunto de 150 mm × 100 mm onjunto de 150 mm × 100 mm onjunto de 150 mm × 100 mm onjunto de observação MIX* ICC* ubos intermediários ltros ltros ltros ltros ltro para condensador aca de platina uporte de espécime	ondensador (longa distância de trabalho)	ondensador (longa distância de trabalho)  DYCP (x1)  Refletida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópi Refletida/Aprox. 18,3 kg (40,3 lb) (estativa do microscópi Refletida/Arransmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 lb) (estativa do Observação BF/POL/FL  MPLFLNSX, 10X, 20X, 50X, 100X  Diplunto MPLFLN BD  PIETIN-BD, LMPLFLN-BD  PIETIN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD  PIETIN-BD, MXPLFLN-BD  PIETIN-BD, MXPL	andensador (longa distância de trabalho)  Disco de alimentação  UYCP (x1)  Refletida: Aprox. 15.8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópio: 7,4 kg (16,3 lb)) Refletida/transmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 lb) (estativa do microscópio: 7,6 kg (16,8 lb)) Observação BF/POL/FL  MPLFLNSK DOSAN, 100X  Observação BF/POL/FL  MPLFLNSK DOSAN, 100X  Observação BF/DF/DIC/POL  MPLFLNSK DD, 10XBD, 20XB  Observação BF/DF/DIC/POL  MPLFLNSK DD, 10XBD, 10X	ondensador (longa distância de trabalho)  Denjunto MPLFLN  Dipunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD  PLEIN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo USIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP64  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo U-SIC64, U-SHG, U-SP65, U-SP6	Indensador (longa distância de trabalho)  — U-LWCD — U-LWCD —  Debo de alimentação  UVCP (x1)  Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,4 kg (16,3 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (16,8 lb) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópico: 7,6 kg (16,8 lb)) Reflectida: Aprox. 15,8 kg (16,8 lb) Reflectida: Aprox. 15,8			

Não pode ser usado com o U-5RE-2

#### Unidades BX53M/BXFM ESD

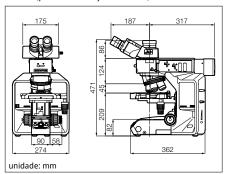
	Estativa do microscópio	BX53MRF-S, BX53MTRF-S
	Iluminador	BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S
Itens	Porta-objetivas	U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D5BDRES-ESD, U-SRES-ESD
	Platina	U-SIC4R2, U-MSSP4

				- A ·			n		
Sistema óptico				Fluorescência Sistema óptico UIS2 (corrigido para o	infinito)	Infravermelho	Polarização		
•	Estativa do micros	cópio T		BX53MRF-S (Refletida)	BX53MTRF-S (Refletida/transmitida)	BX53MRF-S (Refletida)	BX53MTRF-S (Refletida/transmitida)		
		Foro		Traço fino por rotação: 100 µm	Percurso: 25 mm Traço fino por rotação: 100 µm				
		Foco		Indy into por toacțae. 100 pm Regulação mínima: 1 µm Com limite macrométrico superior, ajuste de torque para botão macro					
		Altura máx. da amostr	a	1	mm (com BX3M-ARMAD) Refletida/transmitida 35 r	nm (sem espaçador) 75 mm (com BX3M-ARM	AD)		
		Campo amplo (FN 22)	Lanta Bartunad	U-TR30-2 invertido: trinocular		U-TR30IR invertido: trinocular para IV	U-TR30-2 invertido: trinocular		
	Tubo de observação	Acessório intermediário de luz polarizada (U-CPA)	Lente Bertrand Limitador de campo Bertrand Ativar ou desativar a troca de lentes Bertrand entre observação ortoscópica e conoscópica	_			Focalização  ø3,4 mm de diâmetro (fixo)  Posição do deslizador dentro Posição do deslizador fora		
			Suporte do analisador						
			Observação FL		codificada, torre da unidade de espelho de 4 J-FWGS, U-FBF etc.) com FS, AS (com mecanismo de	-	(U-AN360P-2)		
		Luz refletida	Observação IV			BX3M-RLA-S Lâmpada de halogênio de 100 W para IV, BF/IV, AS (com mecanismo de centralização) U-LH100IR			
	Iluminação		Observação IV		_	(incluindo 12V10W HAL-L) Fonte de luz de halogênio de 100 W para IV Fonte de alimentação TH4-100 de 100 W Controlador manual TH4-HS Cabo de extensão U-RMT	_		
		Luz transmitida	Observação POL		-		BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distânci de trabalho		
Conjunto principal	Revólver porta-objetívas giratório			U-D6BDRES-S Para BF/DF: sèxtuplo, codificado		<b>U-5RE-2</b> Para BF: quíntuplo	U-P4RE Quádruplo, componentes acopláveis centralizáveis, lâmina de retardo de comprimento de onda de 1/4 (U-TAD), cor de placa (U-TP530) e vários compensadores podem ser acoplados usando o adaptador de placa (U-TAD).		
	Ocular (FN 22)			WHN10X WHN10X-H			CROSS-WHN10X		
				U-FDF Para DF			CROSS THINTON		
				U-FBFL Para BF, filtro ND integrado					
	Unidades de espel	ho		U-FBF Para BF, filtro ND removível U-FWUS Para FL ultravioleta			_		
				U-FWBS Para FL azul		]			
				U-FWGS Para FL verde					
				U-25FR Filtro azul		U-BP1100IR/U-BP1200IR Filtros de trajetória de banda para IV	43IF550-W45 Filtro verde		
	Filtro/Polarizador/Analisador			U-POIR Deslizador polarizador refle	etido para IV	U-AN360IR Deslizador analisador rotativo para IV	U-AN360P-2 Indicador de 360º giratório com ângulo mínimo de 0,1º		
	Condensador			U-LWCD Longa distância de trabalho		-	U-POC-2 Condensador acromático livre de tensão Polarizador de rotação de 360° com ler superiores acromáticas swing-out. O botão de parada na posição "0" é ajust AN 0,9 (lente superior dentro)/AN 0,18 (lente superior fora) biafragma da áris de abertura: ajustáve dos diâmetros de 2 mm a 21 mm.		
	Deslizador/Compe	nsadores					U-TAD Deslizador (adaptador de placa) U-TP530 Placa de tonalidade U-TP137 Placa de retardo de comprime		
	Cabo de alimentaç	ão		UYCP (x1)			de onda de 1/4 UYCP (x1)		
	Peso Guia de luz			Refletida: Aprox. 15,8 kg (34,8 lb) (estativa do microscópio 7,4 kg (16,3 lb))	Refletida/transmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 lb) (estativa do microscópio 7,6 kg (16,8 lb))	Aprox. 18,9 kg (41,7 lb) (estativa do microscópio 7,4 kg (16,3 lb))  Aprox. 16,2 kg (35,7 lb) (estativa do microscópio 7,			
uorescência fletida fonte	Guia de luz			Conjunto de luz guia U-LGPS, U-LLGA					
luz	Lâmpada de merci	úrio		Conjunto de lâmpadas de mercúrio U-LH100HGAPO1-7, USH-103OL (x2), U-RFL-T, U-RCV  Observação BF/DIC/POL/FL  MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X					
	Conjunto MPLFLN	BD		Observação BF/DF/DIC/POL/FL MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD	, 100XBD		_		
bjetivas	Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD			Observação BF/DF/DIC/POL/FL MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XB	BD. 50XBD. 100XBD				
ojeuvas	Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD		LN-BD	Observação BF/DF/DIC/POL/FL, MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLI		Observação IV			
	Conjunto IV  Conjunto POL					LMPLN5XIR,10XIR, LCPLN20XIR,50XIR,100XIR	Observação POL		
	Conjunto de 76 mr	n x 52 mm		UPLFLN4XP,10XP,20XP,40XP  Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) × 52 mm (Y), com ajuste de torque					
	Conjunto de 100 m			U-SYRM, U-MSSP  Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y  U-SICAR2, U-MSSP4					
atina (V v \^	Conjunto de 100 n	nm × 100 mm (G)		Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)  U-SIC4R2, U-MSSPG					
atina (X × Y)	Conjunto de 150 n	nm × 100 mm		Platina com haste direita coaxial de gr U-SIC64, U-SHG, U-SP64					
	Conjunto de 150 mm × 100 mm (G)  Conjunto POL		Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no U-SIC64, U-SHG, U-SPG64			u-SRP+U-FMP Platina de polarização qiratória			
		enuscão MIV÷		BY3M_CD_BY3M_UC_II_MITVO >	ILMIYDCBI		+ platina mecânica		
	Conjunto de obs	oci vačan INIV.		BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-DICR	O-WIARCDL				
	DIC* Tubos intermediários			U-CA, U-EPA2, U-TRU					
	Filtros			U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR					
pcional		ensador				43IF550-W45, U-POT  U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43			
pcional	Filtro para cond Placa de platina			43IF550-W45, U-POT U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WH	IR65, U-WHP2, BH2-WHR43				
)pcional	Filtro para cond	cime		43IF550-W45, U-POT	IR65, U-WHP2, BH2-WHR43				

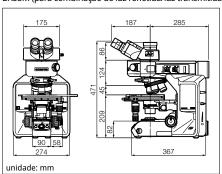
26

## **Dimensões**

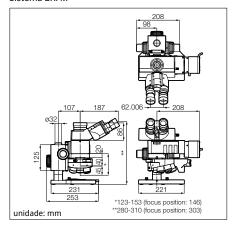
#### BX53M (para combinação refletida)



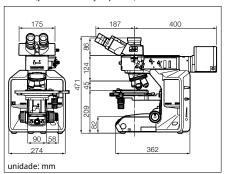
#### BX53M (para combinação de luz refletida/luz transmitida)



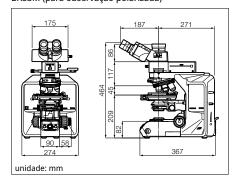
#### Sistema BXFM



#### BX53M (para observação por IV)



#### BX53M (para observação polarizada)



**Evident Corporation** Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio 163-0910, Japão